

<第34回フォトポリマー講習会>

日時:2024年8月29日(木)・30日(金) 9時15分～17時20分

会場:オンライン開催(Zoom)

協賛:(社)日本化学会

[参加費]

会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)

日本化学会会員:18,000円

非会員:28,000円、学生 8,000円

[参加申込]

当ホームページ(<http://www.tapi.jp>)のメールフォームからお申し込み下さい。

受付後、事務局より参加方法についてご連絡いたします。

※テキストはメールフォームによる申し込み者にのみPDF配信いたします。

[締め切り]

2024年8月15日(木)

[基礎編](8月29日(木)第1日目)

09:15～09:20 会長挨拶

大阪公立大学

堀邊 英夫

09:20～10:30 「光化学の基礎と分子デザイン」

成蹊大学

稲垣 昭子 氏

10:40～11:50 「光開始剤によるラジカル生成とその反応素過程に対する高速 ESR 分光観測」

神奈川大学

河合 明雄 氏

13:00～14:10 「ポリマーの光化学と特性」

大阪公立大学

岡村 晴之 氏

14:20～15:30 「リソグラフィ技術の基礎とフォトレジストの材料設計」

大阪大学

遠藤 政孝 氏

15:40～16:50 「フォトポリマーの特性評価」

リソテックジャパン(株)

関口 淳 氏

16:50～17:20 第1日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム

[応用編](8月30日(金)第2日目)

9:20～10:30 「光開始剤の基礎と反応」

BASF ジャパン(株)

鮫島 かおり 氏

10:40～11:50 「光酸発生剤と先端フォトポリマー材料への応用」

富士フイルム(株)

土村 智孝 氏

13:00～14:10 「感光性耐熱材料の開発と事業化」

三井化学(株)

表 利彦 氏

14:20～15:30 「微細加工用レジスト」

兵庫県立大学

渡邊 健夫 氏

15:40～16:50 「トピックス 光オンデマンド法の展開」

神戸大学

津田 明彦 氏

16:50～17:20 第2日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム